本書は、触媒学会創立 50 周年記念事業の一環として、触媒学会の総力を挙げて企画・ 編集し、刊行するものである。触媒学会では、50 周年記念出版を行うにあたり、賛助会 員企業に対して、どのような書物の出版が望まれるかのアンケート調査を行った。その結 果、1967 年に発刊され絶版になっていた「元素別触媒便覧(触媒工学講座第 10 巻)」に 類する便覧的書物の出版を望んでいることがわかった。理事会にて個人会員の意見もあわ せて検討し、全く新たな編集方針により構成、内容を全面改訂して、「触媒便覧」を刊行 することにした。

触媒は、環境、エネルギー、資源という地球規模の3大課題を解決するための鍵物質・ 機能材料として、また、化成品、ポリマー、医薬、農薬など精密有機合成を可能にし、あ るいは情報(機能素子)、バイオ(タンパク質、酵素、遺伝子など)、安全・安心などに資 する物質・材料として、文化的で持続的な人類社会の発展を実現するため、触媒の研究・ 開発は、現代および今後の科学技術が取り組むべき中心課題の1つである.しかし、触媒 に求められる社会的・産業的要請あるいは研究課題はますます高度で厳しく、複合的であ り学際的でもあって、それに対応する触媒科学も従来の触媒化学単独での発展というより も境界領域、融合領域の発展とあいまって複合的に推進されると思われる.新フロンティ アとしての触媒科学・技術の発展が望まれる.今後も、触媒・触媒反応は、人類社会に必 要な物質・材料を提供し、環境・エネルギー問題解決とも関連して、人類社会の持続的発 展を保証する鍵物質・鍵反応であることはまちがいない.

要請される革新的触媒・触媒プロセスの発見・開発には、これまでの蓄積された知識と 方法論の最大限の理解と利用が必須であると同時に、新しいアイディアが必要である.し かし、10年前とは隔絶の感がする表面科学や計算科学の進歩,触媒合成法・調製法の開拓, 触媒反応の開発、プロセス工学の進展、環境・エネルギーなど、広範な研究対象への展開, 扱う触媒の種類の多様化と深化などが進み、触媒の専門家でも自身の専門から少し離れた 触媒や反応、あるいは手法や解析法を理解し、その知識・技術を利用することは容易では ないし、ヒントを得ることもむずかしい.むしろ全く対応できないことも多い.このよう な状況で、触媒・触媒反応に関する知識を、簡単にしかも的確な情報として手に入れるこ とができる書物が望まれるのは当然である.

本書は、上記の観点より、I基礎編、II解析編、II触媒編、IV反応編の4編を解説編と して、さらに、V資料編を設け、便覧の特長を生かしつつ、触媒の基礎的・工学的知識、 解析法、触媒の構造と性質、反応機構、触媒調製法、多様な反応プロセスの操作などが理 解でき容易に利用できるようになっている、全体を通して、確立されたものだけでなく最 近の課題にも対応できるようにし、最新の学術および科学技術を含め、実社会で必要な最

## 編集委員一覧

(五十音順)

#### 委員長

小野 嘉夫 東京工業大学名誉教授

御園生 誠 東京大学名誉教授

#### 副委員長

岩澤 康裕 東京大学

- 委員(\*印:幹事)
  - 朝倉 清高 北海道大学 \*辰巳 敬 東京工業大学
  - 稲永 純二 九州大学
  - 岩本 正和 東京工業大学
  - \*上田 涉 北海道大学
  - 江口 浩一 京都大学
  - \*小澤 文幸 京都大学
  - \*瀬戸山 亨 (株)三菱化学科学技術研究 センター

- 出口 隆 触媒学会
- 寺岡 靖剛 九州大学
- \*堂免 一成 東京大学
- \*春田 正毅 首都大学東京
- 水野 哲孝 東京大学



図 1.1 メタノールの合成と分解の平衡転化率の温 度と圧力依存性. [産業技術総合研究所 櫻井宏昭博士作成]

 $-\Delta r G^{0} = RT \ln K$ -  $\Delta r G^{0} =$ RT ln [CH<sub>4</sub>] [H<sub>2</sub>O] / [CO] [H<sub>2</sub>]<sup>3</sup> (1.5)

となる. 平衡定数 Kの値は, 200℃以上に なると 10<sup>-2</sup> 以下となり, すなわち反応は 実質上左側に進行する.

実際の反応は、複数の素反応過程を経て 進行する.最も単純な反応である CO 酸化 でも、固体触媒上では、次の素反応を経由 して進行すると考えられる.

 $CO+S \rightarrow CO-S$  S:触媒表面 (1.6)

 $1/2O_2 + S \rightarrow O - S \tag{1.7}$ 

 $CO-S+O-S \rightarrow CO_2-S+S$  (1.8)

 $CO_2 - S \rightarrow CO_2 + S$  (1.9)

全体として  $CO + 1/2O_2 \rightarrow CO_2$  (1.10)

このうち最も遅い素反応の速度が、反応全



図 1.2 無触媒(点線),パラジウム触媒(実線) 上での一酸化炭素と酸素との反応のエネル ギー状態図.[山下弘巳ほか,触媒・光触 媒の科学入門,p.2,講談社(2006)]

体の速度となる.また、それぞれの素反応 過程の速度は、その量論式に沿った反応次 数で表わされる.すなわち、(1.8)の素反 応過程が律速である場合、その速度式は (1.11)式で表わされるが、これが反応全 体の速度とほぼ一致する.

$$rate = k[CO-S][O-S]$$
(1.11)

表面吸着種の濃度 [CO-S], [O-S] は, 触媒表面での吸着平衡を想定すれば, CO と O<sub>2</sub> の気相濃度(分圧)との関係式で表 わされるので,最終的に [CO] と [O<sub>2</sub>] の分圧で反応全体の速度が表現される.

図1.2 は、触媒を使用しない場合とパラ ジウム触媒を用いた場合の CO 酸化経路の エネルギー状態図である<sup>1)</sup>. 触媒がないと 反応の障壁が非常に高いが、パラジウム触 媒があるといくつかの素反応に分かれ、し かもそれぞれの素反応の反応障壁が小さく なるので、全体の反応が進行しやすくなる.



 図 2.7 反応進行度の温度依存性(反応時間1時間における1次反応の進行度). (a)活性化エネルギー
 一定(*E*<sub>a</sub>=100 kJ mol<sup>-1</sup>)で頻度因子を変化させた場合. (b)頻度因子一定(A=10<sup>6</sup> s<sup>-1</sup>)で活 性化エネルギーを変化させた場合.

階反応の全体としての速度である.実験的 に得られる複合反応の速度定数を見かけの 速度定数(2.3節)といい、その温度依存 性をもとに得られる活性化エネルギーを見 かけの活性化エネルギー(apparent activation energy)という.見かけの活性化エネ ルギーは、複合反応の反応系のエネルギー と律速段階の素反応における活性錯合体の エネルギーとの差に相当すると考えられる.

アレニウス式は、そもそも有限の温度範 囲で成立する法則であるが、温度範囲を広 げると直線関係からはずれてくる現象も、 実際に多く見いだされている.このような 直線関係からのずれや折れ曲がりが観測さ れる場合は、温度に依存した①反応経路の 変化、②律速段階の変化、③触媒の状態変 化(相転移など)、のいずれかが存在する と解釈される.このほかに実際には、④副 反応の消長(選択性の変化),に注意する 必要がある.温度変化に伴って選択性が大 きく変化する場合には,目的とする反応の 速度だけを分離して議論する必要が生じ る.温度を上げていくと逆反応が無視でき なくなる場合もある.

触媒反応における多段階過程で特に注意 が必要なのは、物質移動律速についてであ る.触媒反応の中でも発熱の大きな反応は 非常に速い場合が多く、このような場合に 物質移動が律速になることが多い.たとえ ば固体触媒による反応の温度依存性におい て、高温側でアレニウスプロットの傾きが 寝る現象がしばしば観察される.これは、 境膜拡散や粒子内拡散(2.1.2.B項)が律 速になるためであり、活性化エネルギーは 前者では約20kJ mol<sup>-1</sup>以下、後者では真 の活性化エネルギーの約1/2となる.

### 2.5 ターンオーバー数、ターンオーバー頻度

触媒の活性を表す指標として、通常、触 媒量(モル数、重量、表面積、体積)あた りの反応速度(比速度)や反応速度定数が 用いられる.しかし、触媒の活性点の数を 特定することができれば、活性点あたりの 指標、すなわちターンオーバー数(turnover number, TON) やターンオーバー頻度 (turnover frequency, TOF)を用いるほう が, 触媒活性点のもつ固有の触媒能を評価 するのに適している.

#### **2.5.1** ターンオーバー数

触媒反応において、1つの活性点が平均 何回反応に寄与したかを表す数である。一 定の反応時間における反応分子数を、触媒 活性点数で割り算することで得られる



# 触媒反応工学

### 6.1 反応装置の分類

反応装置はその形状から,図 6.1 に示す ように槽型と管型に大別される.また操作 法からは,回分式,流通式と半回分式に分 類される.

## 6.1.1 回分式操作,流通式操作,半回 分式操作

回分式操作は、反応原料をすべて仕込ん でから反応を開始し、適当な時間が経過し た後に反応混合物を取り出す操作法であ る.回分式操作には槽型反応器が用いられ る.流通式操作は、反応原料を連続的に反 応器入り口に供給して反応器出口より生成 物を連続的に取り出す操作法であり、槽型 反応器および管型反応器が用いられる.半 回分式操作は、反応原料の1成分(たとえ ば成分 B)を最初に槽型反応器に仕込んで おき、そこに別の原料成分(成分 A)を、 連続的あるいは間欠的に流入させながら反 応を進行させる操作法であり、成分 Bに ついては回分式であるが、成分 A に関し ては流通式となる.

大量生産が要求される化学工業では、流 通式操作が有利である.流通式操作では反 応装置内で定常的に反応が進行するため、 自動制御が容易で均一な製品が得られる. 一方、製薬工業のように少量多品種の製品 を製造するファインケミカル工業では、回 分式操作あるいは半回分式操作が適してい る.また発酵工業では、長期間にわたり無 菌操作が困難であるなどの理由から流通式 操作の例は少ない.

#### 6.1.2 反応装置の形状と装置内流れ

槽型反応器では、槽内の均質化と物質・ 熱移動の促進のため、通常は撹拌翼によっ て器内の反応流体が十分に混合され、反応 物質の濃度と温度が器内で均一とみなせ る.この反応器は、均一液相反応のほかに 気液反応、気液固触媒反応、液液反応など の不均一反応にも用いられ、適用範囲が広 い反応器である、槽型反応器を回分式操作



図 6.1 形状と操作法からの反応装置の分類.

説明されているので,詳細は省略する.

#### 9.1.4 触媒反応段階

触媒反応段階については、活性、選択性、 寿命の評価(いわゆる触媒活性試験)と. 反応機構の解明につながる触媒活性点や反 応中間体の解析に大別される。前者では、 反応物、生成物の同定と濃度測定のための ガスクロマトグラフ. 質量分析計. NMR などの分析装置を、反応系や測定対象分子 に応じて使い分ければよい. 後者に対して は、反応結果とex-situ測定で得た情報か ら推定する例も多いが、実際に反応が進行 している条件下での測定(*in-situ* 測定)か ら. より直接的な情報が得られる. in-situ 測定では、赤外分光法(IR)やラマン分光 法を用いる吸着種の同定や、XAFS を用い る活性点や活性点を含む中間体の構造解析 が最もよく用いられる(10.5節参照).また. 温度、雰囲気が制御可能なアタッチメント を用いた XRD では. 触媒バルク構造の in*situ* 測定が可能である.

触媒反応段階の解析ではないが,比較的 単純で反応機構がよくわかっており,表面

表 9.3 代表的なモデル反応と得られる情報

| モデル反応  | 得られる情報                     |
|--|----------------------------|
| H2-D2交換反応  | 水素の解離,活性化能                 |
| <sup>16</sup> O <sub>2</sub> - <sup>18</sup> O <sub>2</sub> 交換反応 | 酸素の活性化能,表面酸素・バ<br>ルク酸素の反応性 |
| ブテン異性化反応   | 酸・塩基特性                     |
| クメン分解反応  | 酸性質(強度,量)                  |

特性に敏感な反応(モデル反応)を用いて, 触媒表面特性に関する情報を得る方法があ る.代表的なモデル反応と得られる情報を 表9.3にまとめる.これら以外にも,CO酸 化反応やNO直接分解反応などの反応も表 面酸化力などのテスト反応に用いられる.

#### 9.1.5 解析法と得られる情報

9.1.1~4では、触媒研究に必要な情報か ら、それに適した解析法を紹介、説明した. 一方、その逆の分析法から得られる情報を 理解しておくことも、研究を進めるうえで 重要である.触媒研究者が多用する機器分 析法を、この観点から表 9.4 にまとめる. 「寺岡靖剛・永長久寛]

| 解析法                            | 得られる情報など<br>結晶構造<br>ビークの解析から結晶子径(必ずしも粒子径ではない)や格子歪に関する情報が得られる<br>低角度側の散乱部分の解析からナノ粒子の平均粒子径が推定できる(X線小角散乱:SAXS)                                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| X 線回折法(XRD)                    |  |  |  |  |  |  |
| 走査電子顕微鏡(SEM)<br>透過電子顕微鏡(TEM)   | 触媒粒子の形状、粒子径が直接観察できる<br>EDX (エネルギー分散型 X 線分析:XRF の 1 つ)との併用により, SEM, TEM の観察オーダー<br>での局所元素分析が可能<br>TEM では、電子線回折によりナノ領域での構造解析が可能                  |  |  |  |  |  |
| 走査トンネル顕微鏡(STM)<br>原子間力顕微鏡(AFM) | 原子サイズの分解能をもち、原理的には原子、分子の直接観察が可能  |  |  |  |  |  |
| 紫外・可視分光法(UV-vis)               | d−d 遷移, 金属と配位子間の電子遷移から, 価数, 配位構造, 配位子場などの情報が得られる<br>固体のバンド間遷移(吸収端)の解析からバンドギャップエネルギーが見積もれる  |  |  |  |  |  |
| X 線吸収分光法(XAFS)                 | X線吸収端近傍構造(XANES)の解析から、測定原子の電子状態,結合(配位)している原<br>子の種類,結合様式,配位構造に関する情報が得られる<br>広域X線吸収微細構造(EXAFS)の解析から,測定原子の周囲の局所構造(結合距離,配位数,<br>構造の乱れ)に関する情報が得られる |  |  |  |  |  |
| 赤外吸収分光法(FTIR)<br>ラマン分光法        | 分子等の結合や構造に関する情報が得られ、吸着種、反応中間体の同定、XRD で検出できな<br>い固体の構造の同定などが可能  |  |  |  |  |  |
| 核磁気共鳴法(NMR)                    | 溶液 NMR はおもに有機化合物の構造解析に、固体 NMR は測定対象原子の配位環境(配位数,<br>配位元素の種類など)の測定に用いられる   |  |  |  |  |  |

表 9.4 代表的な機器分析と得られる情報

#### 9.2.12 赤外分光法

#### A. 原 理

赤外分光法(IR)は代表的な振動分光法であり、分子などの結合や構造に関する直接的な情報が得られ、有機化合物の構造決定などに多用されている<sup>1~4)</sup>.これは触媒表面に吸着した分子の同定や定量にも有用な手法である.現在では、フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)が一般的であり、従来の分散型赤外分光光度計より感度がすぐれているため広く利用されている<sup>4)</sup>.FTIRでは、干渉計によって得られる干渉波をフーリエ変換して、全波数領域のスペクトルが同時に得られる.通常のFTIRでは400~4000 cm<sup>-1</sup>の領域の測定が可能である.高感度で高速の赤外光の検出にはMCT (HgCdTe)などの半導体検出器が用いられる.

#### B. 特 徵

IR は光子をプローブとする分析法であり、 電子分光法のように試料を真空下におく必要が ないために、気相存在下の触媒表面の insitu 観察に適した手法である. 触媒表面や固体表面 の赤外分光観察においては、表面吸着分子の数 はバルクの物質に比べると非常に少ないため に、高感度な測定が要求される. IR は低波数領 域では触媒自身の振動による吸収も強く、検出 器の感度も低いことから、この領域のスペクト ルの測定は困難である. また、FTIR の干渉計 を高速スキャンすると、数十 ms でスペクトル を得ることもできる. さらに、FTIR を用いる時 間分解赤外分光法では、ns から µs の時間領域 で時間分解赤外スペクトルの測定が可能である.

#### C. 測定法

#### a. 透過法

粉体の触媒を薄いディスク状にプレス成型す ることによって、赤外線を透過する触媒試料を 作ることができる.また、粉体の触媒を CaF<sub>2</sub> などの赤外用窓材に薄く塗布しても同様な試料 を作ることができる.この試料をセル内に設置 し、所定の前処理をしたのちに、セル中に試料 ガスを導入し触媒表面に吸着した分子の吸収ス ペクトルが測定できる.測定セルの一例を図1 に示す.セルは標準的な分光光度計の試料室に 設置される.光学系が簡便で感度の高い測定が





可能である.

透過吸収法では吸着分子数と透過赤外光の強度との間にはランベルト-ベールの法則が成り 立つ.入射光量 I<sub>0</sub>と透過光量 I に対して log (I<sub>0</sub> /I) は吸光度とよばれ,吸着種の量に比例する. これを縦軸にとれば,吸収ピークの面積強度から吸着分子の量を求めることができる.

#### b. 拡散反射法

拡散反射法は, 粉体触媒試料に赤外光を照射 し粉体粒子の透過や反射を繰り返すことによっ て試料から放出される拡散反射光を検出し,ス ペクトルを得る方法である.拡散反射光は広い 方位角で放出されるため,立体角の大きい集光 鏡が必要である.測定法の模式図を図2に示す. 透過法においては吸光度が濃度に比例するが, 拡散反射法においては縦軸が濃度に比例したス ペクトルにするためには, クベルカームンク則 に基づいた K-M 変数を縦軸にとる.





c. 反射吸収法

反射吸収法は、平滑金属表面に赤外光を大き



図 10.52 Ru(0001) 表面をNO(300 K, 0.1 L) に 露出した後の6分後(a) および2時間 後(b)のSTM 像.

じた窒素原子がステップエッジ近傍に多数 みられる.酸素は表面拡散が早いので、ス テップから離れたところにも分散してい る. 図(b) は2時間後の結果であるが. 窒 素原子が表面拡散によってしだいにステッ プエッジから離れていることがわかる. こ のステップエッジから窒素の距離について 時間変化を追跡したのが、図の結果である。 この結果から, 窒素原子の拡散速度が求め られた. また同時に. ステップエッジが NO 分子の解離サイトであることが示され た. すなわち. Ru 表面の一部のサイトが NO 分子を解離させるのである。もし、解 離に引き続いて窒素原子が Ru(0001)の平 坦部 (テラス) で水素などと反応が起こる としたら. ステップエッジとテラスの両方 が反応場所となる、このように実際の触媒 反応では、別々の場所で反応が起こること

が数多くあると考えられる.

#### 10.6.5 担体効果

SMSI (strong metal-support interaction) 効果とよばれる金属触媒の担体効果が、 1970年代ごろより研究されていた.たと えば Rh/TiO<sub>2</sub> 触媒において、水素還元に よって活性が著しく劣化するが、酸化する と活性が回復するという現象がある.この 機構に関して、Rh 微粒子表面をTiO<sub>x</sub>種が 覆うというモデルが提出されていた.還元 されやすい金属酸化物が微粒子となって金 属触媒の表面を被覆するという挙動は、他 の系でも考えられるが、その構造や挙動は 原子レベルでは理解されていなかった.近 年になって、Rh 表面の金属酸化物種が特 異なユニットを作る現象が見いだされ た<sup>8)</sup>.

図 10.53 に、酸化バナジウムを Rh(111) 表面に生成させたときの STM 像を示す. Rh(111) に原子状酸素を吸着させておき バナジウムを蒸着させると、図 10.53(a) に示すような二次元のバナジウム酸化物の 島が生成する.その構造は V<sub>13</sub>O<sub>21</sub>のユニッ トからなり、6(V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) + VO<sub>3</sub> という構造に なっている.これを酸素分子で酸化すると、 図 10.53(b)、(c) に示すような、星型の酸 化バナジウムのユニットが島から離脱して くる.この星形クラスターは、第一原理密



図 10.53 Rh(111) 表面に生成する酸化パナジウムの STM 像. (a) 二次元の V<sub>13</sub>O<sub>21</sub> ユニットからなる島と星形クラスターが見える (150×150 nm<sup>2</sup>), (b) より拡大した像 (20×20 nm<sup>2</sup>), (c) 星形の像の 1 つが V<sub>6</sub>O<sub>12</sub> に対応 (6.3×6.3 nm<sup>2</sup>).

れている<sup>2~4)</sup> が,標準的には高温での調 製が一般的である(表 11.12).特に高表面 積材料や,過剰炭素が表面に存在しないよ うな方法に興味がもたれている(表 11.13).

#### C. 触媒作用

炭化物や窒化物の触媒作用については, 最近のハイドロプロセシングをはじめ多く の総説に紹介されている<sup>12~14</sup>.炭化物や 窒化物は,水素移行反応を含む多様な反応 にすぐれた活性を示す.過去に,WCが 白金類似の触媒活性を示すと報告されたた め,炭化物,窒化物は多くの注目を集め た<sup>15)</sup>.この類似性は活性よりも選択性にお いて顕著であり,概念は重要な指導原理と なっている<sup>16,17).</sup>

340 ℃, 3.1 MPa, LHSV 5 h<sup>-1</sup> における ベンゾチオフェンおよびキノリンの同時水 素化脱硫 (HDN),水素化脱窒素 (HDN) 反応については,統一的な評価がされてお

表11.12 低表面積材料の調製

|    | 反応の種類   | 例   |
|----|---|---|
| 1. | 金属と非金属の直接反応<br>炭化物 M+C → MC<br>袋化物 M+1/2N. → MN   | Mo <sub>2</sub> C, Mn <sub>23</sub> C <sub>6</sub> , TiC, TaC, NbC, W <sub>2</sub> C-WC<br>TiN VN C-N |
| 2. | <ul> <li>金属酸化物と固体炭素の反応</li> <li>炭化物 MO+2C → MC+CO</li> <li>窒化物 MO+C + 1/2N<sub>2</sub> → MN+CO</li> </ul> | ScC, YC, TiC, NbC, TaC, Cr <sub>3</sub> C <sub>2</sub> , Mo <sub>2</sub> C, HfC<br>TiN, VN, CrN       |
| 3. | 自己熱反応<br>炭化物 $M+C$ $\longrightarrow$ $MC$<br>窒化物 $M+1/2N_2$ $\longrightarrow$ $MN$                        | TiC, ZrC, HfC, NbC, SiC, $Cr_3C_2$ , $B_4C$ , WC TiN, ZrN, BN, AIN, $Si_3N_4$ , TaN                   |

表 11.13 高表面炭化物および窒化物の調製法

|                     | 反応の種   | 例  |   |
|---------------------|--|--|---|
| 気固反応<br>炭化物<br>窒化物  | M+2CO<br>MO <sub>x</sub> +NH <sub>3</sub>  | $ \longrightarrow MC + CO_2 $ $ \longrightarrow MN + H_2O $  | Cr <sub>3</sub> C <sub>2</sub> , Mo <sub>2</sub> C, Fe <sub>3</sub> C, Co <sub>2</sub> C<br>TiN, ZrN, HfN, VN, W <sub>2</sub> N |
| 金属塩化物<br>炭化物<br>窒化物 | の分解<br>MCl+H <sub>x</sub> C <sub>y</sub><br>MCl+N <sub>2</sub> /H <sub>2</sub>                                     | $ \longrightarrow MC + HCl + \cdots \\ \longrightarrow MN + HCl $  | TiC, TaC, HfC<br>TiN, VN, Re <sub>2</sub> N, Fe <sub>4</sub> N, Cu <sub>3</sub> N   |
| 金属化合物<br>炭化物<br>窒化物 | の分解<br>W(CO) <sub>n</sub> +H <sub>x</sub> C <sub>y</sub><br>Ti(NR <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> +NH <sub>3</sub>     | $\longrightarrow$ WC + H <sub>2</sub> O + Co<br>$\longrightarrow$ TiN +                                      | HfC, VC, WC<br>TiN, Zr <sub>3</sub> N <sub>4</sub>  |
| 昇温還元(<br>炭化物<br>窒化物 | $\begin{array}{l} \text{TPR})\\ \text{MoO}_3 + \text{CH}_4 + \text{H}_2\\ \text{WO}_3 + \text{NH}_3 \end{array}$   | $\longrightarrow$ Mo <sub>2</sub> C<br>$\longrightarrow$ WN  | $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$  |
| 高表面積担<br>炭化物<br>窒化物 | 体の使用<br>Mo(CO) <sub>6</sub> /Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>TiO <sub>2</sub> /SiO <sub>2</sub> +NH <sub>3</sub> | $\longrightarrow$ Mo <sub>2</sub> C/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>$\longrightarrow$ TiN/SiO <sub>2</sub> | Mo <sub>2</sub> C / Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>TiN/SiO <sub>2</sub>  |



図 12.2.22 MWW 構造の模式図.

熱合成時の原料組成を制御することで、 MWWのトポロジーをもちながら、平板 厚さが非常に小さいゼオライト MCM-56 も見いだされている<sup>9</sup>. これらのゼオライ トについては、MWW 構造の外表面酸点 を積極的に利用するかさ高い分子の触媒反応に有効であることも明らかになっている.

#### ii) 触媒調製法とその性能

MWW 型ゼオライトは通常, ヘキサメ チレンイミンもしくはピペリジンを構造規 定剤として用いる水熱合成法により得られ る. ピペリジンに比べてヘキサメチレンイ ミンを構造規定剤とするほうが, 幅広い組 成で MWW 相を得ることができる. MWW 構造を有する MCM-22 ゼオライト の調製では, ケイバン比30~70 程度の範 囲で, 結晶性の高い MWW 相が純度よく 得られる. これより低いケイバン比ではゼ オライト相を得ることが困難であり, ケイ バン比100 以上では MTF 相 (MCM-35 ゼオライト) の副成が起こるようになる.



図 12.2.23 MWW 型ゼオライト.

またこのゼオライトの結晶化には、アルカ リ金属源としてナトリウムの添加が必要で あり、ナトリウムフリーでの合成では、こ れまでのところ結晶性の高い MWW 型ゼ オライトを得られていない.なおシリカの みからなる MWW 型ゼオライト ITQ-1は、 *N,N,N*-トリメチル-1-アダマンタンアン モニウム塩を構造規定剤として用いなけれ ばならない (図 12.2.24).

水熱合成時条件としては、結晶化温度 150℃が望ましく、170℃以上ではMFIと の混晶になることが多い.また結晶化には 表 12.2.9 ヘテロポリ化合物による均一系酸触媒反応例

| 反応  | 触媒   |
|---|--|
| 水和反応<br>→ + H <sub>2</sub> O → OH   | $H_{3}PW_{12}O_{40}  {}^{^{+}1}$                             |
| エステル化反応   |  |
| $\bigcup_{OH}^{O} (H) + \bigcup_{OH}^{O} (H) \longrightarrow \bigcup_{OH}^{O} (H) + H_2O$   | $H_{14} Na P_5 W_{30} O_{110} {}^{\dagger  2}$               |
| エーテル化反応   |  |
| $+H_2O$ $\rightarrow$ $2O$  | $H_{3}PW_{12}O_{40}{}^{\dagger3}$                            |
| 異性化反応   |  |
| $HO \longrightarrow 10 + 0$   | $H_{3}PW_{12}O_{40}{}^{\dagger}{}^{4}$                       |
| 重合反応  |  |
| $ \overset{O}{\longrightarrow} \qquad \longrightarrow \qquad Ho ( \overset{O}{\longrightarrow} \overset{O}{\underset{n}{\overset{n}}} H$  | $H_3PW_{12}O_{40}^{+1}$                                      |
| フリーデル-クラフツ反応  |  |
| $\bigcirc OMe + \bigcirc Cl \longrightarrow MeO $   | ${ m H_{4}SiMo_{12}O_{40}}^{+5}$                             |
| プリンス反応  |  |
| +2HCHO  | $H_{3}PW_{12}O_{40}^{\dagger1}$                              |
| アセタール化反応 OMe  |  |
| $0 + 2CH_3OH \longrightarrow 0Me + H_2O$  | $H_{3}PMo_{12}O_{40}{}^{\dagger}{}^{1}$                      |
| マンニッヒ反応<br>O NHR <sup>2</sup>   |  |
| $R^{1}CHO + R^{2}NH_{2} + \qquad $   | $H_{3}PW_{12}O_{40}{}^{\dagger6}$                            |
| リッター反応  |  |
| $ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ + R \end{array} \\ = N + H_2 O \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} $ | $H_3PW_{12}O_{40}$ <sup>+7</sup>                             |
| アルドール反応   |  |
| $R \xrightarrow{N^{-Ar}}{}^{Ph} \xrightarrow{OTMS} R \xrightarrow{Ar_{NH}}{}^{Ph} Ph$   | $[Bu_4N]_5H_2[YbP_2W_{17}O_{61}]^{\dagger8}$                 |
| OTMS Masio O  |  |
| $ \begin{array}{c} & & \\ & & $       | $[Bu_4N]_4[(SiW_{10}O_{32}(H_2O)_2)_2(\mu-O)_2]^{\dagger 9}$ |

†1 Adv. Catal., 41, 113(1996), †2 Appl. Catal. A: Gen., 302, 42(2006), †3 Appl. Catal. A: Gen.,
243, 258(2006), †4 J. Mol. Catal. A: Chem., 259, 99(2006), †5 季刊化学総説, No.20(1993), †6
Org. Lett., 8, 2079(2006), †7 Russ. J. Org. Chem., 42, 966(2006), †8 Angew. Chem. Int. Ed., 45, 3324 (2006), †9 J. Organomet. Chem., 692, 455(2007)

る. もう1つのタイプは, ギブズの自由エ ネルギー変化が負の反応である. このタイ プの反応では, 光触媒の光吸収による電子 と正孔の生成をきっかけに, 化学反応が室 温付近で誘起される. 酸素を用いる有機物 の酸化分解など多くの環境浄化型光触媒反 応は, このタイプに属する.

#### B. 光触媒反応の基礎

光触媒は、錯体や色素などの均一系と金 属酸化物や硫化物等の不均一系に分類され る.この中で多くの固体光触媒は、半導体 的なエネルギーバンド構造をもっている. バンドギャップ以上のエネルギーをもつ光 を照射すると、価電子帯の電子が伝導帯に 励起され、その結果として価電子帯に正孔、 伝導帯に電子を生じる(図12.8.2).そして、 この正孔により水が酸化されて酸素に、一 方で電子により還元されて水素になる.

ここで重要なのは、禁制帯の幅と伝導帯・ 価電子帯のポテンシャルである.水の分解 が可能なバンド構造は、単純に表現すると、 伝導帯の底が H<sup>+</sup>/H<sub>2</sub> の酸化還元電位 (0 V vs. NHE at pH0) よりも負、価電子帯の上 限が  $O_2/H_2O$  のそれ (+1.23 V vs. NHE at



図 12.8.2 半導体光触媒による水の分解反応の機 構 (1).

pH0)よりも正でなくてはならない.すな わち,伝導帯と価電子帯が水の還元および 酸化電位を挟む位置にあればよい.しかし, これらのポテンシャルの関係は,熱力学的 な必要条件であるのにすぎず十分条件では ない.実際には図 12.8.3 に示すように,生 成した電子と正孔の電荷分離,それらの キャリヤーの寿命や動きやすさ,酸化還元 反応における過電圧や反応活性点というよ うな複雑な因子もかかわってくる.そのた め,反応場を供給するためにしばしば助触 媒が表面に担持される.水素生成のための 助触媒として,Pt,NiO,RuO<sub>2</sub>がしばし ば用いられる.

菌や有機物の酸化分解などの環境浄化型 光触媒反応では、光触媒反応によって生成 した活性酸素種(O₂<sup>-</sup>, O<sup>-</sup>, O, OH, HO₂ など)が有機物を分解する(図12.8.4). 正孔が直接目的物質を酸化することもあ る.水分解および環境浄化のいずれの光触 媒反応においても、反応する電子と正孔の 数は等しい.



図 12.8.3 半導体光触媒による水の分解反応の機 構(2).



図 12.8.4 光触媒を用いる有機物の酸化分解機構.



図 13.15 Cossee の活性点モデル.

$$\begin{array}{c} Ti^{-13}CH_3 + C_3H_6 \longrightarrow \\ Ti^{-}CH_2^{-}CH(CH_3)^{-13}CH_3 \end{array} (13.5) \end{array}$$

立体特異性の発現機構も、このCossee のモデルがもとになっている。図 13.15 で チタン種にプロピレンが配位する形を考え ると、プロピレンのメチル基の方向により 4種類の配位形式が予想できる(図 13.16). そしてこの配位の違いが. 続いて 起こる挿入段階に反映される。 プロピレン のメチル基のついたβ炭素が、アルキル 基と結合するように挿入される場合を1.2 挿入、チタンと結合するように挿入される 場合を2.1挿入とよぶ、立体規則性ポリ マーを得るためには挿入時の選択性が必要 であり、この挿入時の選択性を位置選択性 (regioselectivity) という. 上述のように配 位の違いが挿入時の選択性を左右すること から、活性点における立体特異性の発現は、 選択的に一定の配位形式をとらせることと 言い換えることができる.常に配位が同じ 面だけで起こる場合にはイソタクチックポ リマーが、1と2または3と4のように 交互に配位する場合には、シンジオタク



チックポリマーが生成する7)。この配位面 の制御を立体規制 (stereospecificity) とよ ぶ、立体規制には、触媒活性種の構造に起 因する触媒規制.およびポリマー成長末端 の構造に起因する末端規制が存在する. イ ソタクチック重合の立体規制については. 重合は1,2挿入で進行し、その立体規制力 は触媒規制であると考えられており<sup>8)</sup>. そ の機構については、実験的な手法を中心と した推定が行われてきた<sup>9,10)</sup>. さらに近年 寺野らにより、ストップトフロー法重合装 置による短時間重合法と昇温溶離分別装置 を組み合わせた新規な手法が開発され<sup>3,11)</sup> 立体特異的な活性点の濃度やその成長速度 定数を直接求めることが可能となり、活性 点に関してドナーの働きも含めた包括的な 解明が進みつつある.

#### B. メタロセン型触媒

Kaminsky ら<sup>12)</sup> が、Al(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>と水との反応により得られたメチルアルミノキサン MAOとジルコノセン化合物を組み合わせる ことにより、エチレンに対して 1,000 kg-PE g-Zr<sup>-1</sup>·h<sup>-1</sup>·atm<sup>-1</sup>ときわめて高い重合



図 16.16 触媒の透過電子顕微鏡像(線書きはイメージ補強のため). (a) 従来触媒, (b) 開発触媒.

b. FCC ガソリンの脱硫

脱硫減圧軽油や直脱重油を流動接触分解 装置 (fluid catalytic cracking, FCC) で分 解して製造される FCC ガソリンは、多い 場合で硫黄分を数百 ppm 含んでおり、製 品ガソリンに対する混合割合も50%程度 と高い、ガソリンのサルファーフリー化を 達成するためには、FCC ガソリンの低硫 黄化が不可欠である。そのためには、原料 油の前処理である水素化脱硫をさらに強化 する方法もあるが、 重質油の脱硫強化には 膨大な費用がかかるため、製油所によって は FCC ガソリンを直接脱硫するほうがメ リットがある場合も多い.しかし、従来の 技術で水素化脱硫すると、FCC ガソリン に30~40%程度含まれているアルケンが 水素化されてオクタン価が低下する問題点 がある. すべてのアルケンが水素化される と、リサーチ法オクタン価 (RON) の低 下は最大20にもなり、そのままではガソ リンとして使用できなくなる.

この問題点を解決する手段として,選択 的水素化脱硫プロセスがある.これは,FCC ガソリン中のアルケンの水素化反応を極力 抑制しつつ水素化脱硫反応を進めるため, 触媒と反応条件を最適化したプロセスであ る.新日本石油(株)では,選択的水素化 脱硫プロセス ROK-Finer<sup>15)</sup>を開発した. 触媒には,さまざまな工夫がなされている が,Co 担持量の最適化(図 16.17)とCo



図 16.17 Coの添加量と脱硫活性およびアルケン の水素化活性.

分散度の向上もその1つである.

選択的水素化脱硫プロセスは、日本国内 で15基,海外で50基以上がすでに稼動して いる. なかでも Axens 社の Prime-G+<sup>16)</sup> の建設基数が多い。Prime-G+は、オク タン価の低下をより小さくするために、単 一の触媒ではなく二段触媒システムを採用 している。前段はアルケンの水素化を最小 限にする選択的脱硫セクションで、後段は 温度を上げて、副生するチオールを分解す る後処理セクション(フィニッシャー)で ある. Exxon-Mobilの SCAN fining<sup>17)</sup>では、 Co-Mo系の選択脱硫触媒を使用している. チオールを処理するスイートニング装置と 組み合わせる. このように選択的水素化脱 硫プロセスでは, 脱硫反応で生じる硫化水 素とアルケンが反応してできるチオールの 処理も大きな課題である。チオール生成反 応を次式に示す.

#### 参考文献

- V.Z. Fridman, A.A. Davydov, K.Titievsky, J. Catal., 222, 545 (2005)
- 2) 高橋秀也, 触媒, 48,500(2006)
- 3) 米岡幹男, 菅村和弘, ペトロテック, 23, 71

## 17.4 酸塩基触媒反応

## <u>17.4.1 芳香族化合物のアルキル化,ト</u> ランスアルキル化,異性化,ア シル化

ベンゼン・トルエン・キシレン (BTX) を主体とする芳香族炭化水素の製造プロセ スを、図 17.4.1 に示す<sup>1)</sup>.芳香族の転換プ ロセスとして、付加価値の低い原料芳香族 から付加価値の高い p-キシレンなどの製 品芳香族へ転換(増産)するプロセスのほ かに、ベンゼンからエチルベンゼンやクメ ン (イソプロピルベンゼン)、直鎖アルキ ルベンゼンなど、目的とする芳香族化合物 を製造するプロセスがある.これらのプロ (2000)

- 4) 三菱化学, 特開 2004-224768
- 5) N. Ravasio, F. Zaccheria, R. Psaro, A. Fusi, *Chem. Eur. J.*, **2006**, 6426
- セスや反応において,酸触媒として過去に 使われてきた硫酸やリン酸,塩化アルミニ ウムのようなフリーデル-クラフツ型触媒 は,触媒の毒性・危険性や装置に対する腐 食性,および廃棄物が出るなどの点で,人 体や地球環境への影響を考慮すると好まし いものではなかった.そこで,できるだけ 毒性や腐食性がなく,廃棄物がほとんど出 ず,プロセス内での処理が軽減されるなど 「地球環境に調和する」点を重視して,固 体酸触媒の活用が検討されてきた.

酸触媒反応は、プロトン酸点やルイス酸 点において生成するカチオン型の反応中間



図17.4.1 芳香族炭化水素製造プロセスの例.

## 17.5 錯体触媒反応

#### 17.5.1 一酸化炭素関連反応

## A. アルケンのヒドロホルミル化(オキソ法)<sup>1~4)</sup>

アルケン類(炭素-炭素二重結合をもつ 化合物の総称)に水素と一酸化炭素を付加 させ、炭素が1つ増えたアルデヒドを合成 する反応をヒドロホルミル化反応とよび、 この反応を用いるアルデヒド合成法をオキ ソ法とよぶ、プロピレン、1-ブテンなど の一置換エテン(末端アルケン)をヒドロ ホルミル化する場合には、下記の一般式の ように、直鎖体(n体)と分岐体(i体) が生じる.



アルケン類のヒドロホルミル化には,一 般にコバルトとロジウムを触媒として用い る.活性が高く安価な Co<sub>2</sub>(CO)<sub>8</sub> が最も代 表的な触媒前駆体である.工業的には直鎖 体を選択的に生成することが求められ,ロ ジウムのホスフィン錯体(たとえば RhH (CO)(PPh<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)も多用されている.この比 をさらに高めるため、ロジウムの配位子と して、かさ高い二座ホスファイト配位子や、 はさみ角(二座配位子 L<sup>A</sup>L が金属 M に配 位したときの角 L-M-L)の大きい二座ホ スフィン配位子などが開発されている.

また,触媒と生成物の分離を容易にする ため,水溶性ホスフィンのロジウム錯体(た とえば Rh(CO)[P(3-HOSO<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>)<sub>3</sub>]<sub>3</sub>)を 用いて,触媒を水相で働かせる系も工業化 されている.水に溶けにくい高級アルケン については,触媒をフッ素系溶媒に溶かす 二相系も開発されている.図17.5.1 に,ロ ジウムと併用された配位子の代表的なもの を示す.

生成物である直鎖アルデヒドは、①接触 水素化により直鎖アルコールとし、溶剤や 洗剤、可塑剤、②空気酸化により直鎖カル ボン酸とし、溶剤や可塑剤、③アルドール 縮合によりエナールとし、水素添加により 分岐高級アルコールとして可塑剤、合成油、 として用いる、重要な変換反応を(17.5.2) ~ (17.5.4)式に示す.



図 17.5.1 ロジウムと併用された配位子.



図 17.8.4 メタクリル酸メチルの合成経路スキーム.

る汎用原料であるが,いかに安価にこれら を入手できるかが,このプロセス成立のか ぎと思われる.

実用化はされていないが, Shell 社が開 発したプロピン法は一段の反応で, 収率 99%以上で MMA が得られる非常に魅力的 なプロセスである. 原料のプロピン (およ びプロパジエン) は, ナフサクラッカーの  $C_3$ ストリーム中にエチレンの数%にあたる 量が含まれており, 蒸留, 抽出, プロパジ エンの異性化を組み合わせた分離プロセス も開発されているが、年間 100 万トン規模 のエチレンセンターでも MMA として 4 ~ 5 万トンにしかならず、原料問題が最大の 制約条件である.このプロセス技術は Shell 社から ICI 社に譲渡され、現在は Lucite 社 所有と考えられるが、今のところ実用化す る意欲をもっていないように思われる.

C<sub>3</sub>を原料とする方法として過去に盛ん に研究されていた方法に、イソラク酸法が ある. プロピレンと CO と HF 触媒により イソラク酸を合成し、これの酸化的脱水素



以上述べたように、シングルサイト触媒 による高分子合成では、目的とする高分子 の種類に応じて、錯体・助触媒・溶媒を適 切に選択することが重要である.以下にシ ングルサイト触媒を用いる炭化水素系モノ マーの重合について、便宜上モノマー別に 紹介する.なお共重合体においては、これ らの区分にあまり意味はない.

#### **18.1.1 エチレンの重合**<sup>2)</sup>

#### A. 前周期金属錯体

エチレンの重合では,立体特異性を必要 としない点で,錯体の構造に要求される条 件はプロピレン重合ほど厳しくない.しか し LLDPE の合成では,エチレンと1-ア ルケンとの共重合反応性が問題となる. MAO を助触媒として用いる代表的なシン グルサイト触媒のモノマー反応性比を,表 18.1 に示す.

シングルサイト触媒で得られる LLDPE は、活性種が均一であるため組成分布が狭 いことが特長であるが、分子量分布も狭い  $(M_w/M_n=2)$ ため、成形加工性に劣ると いう欠点がある。Dow 社により幾何拘束 型触媒 (CGC) と名づけられた錯体1は. LLDPE 合成用シングルサイト触媒の代表 例である.得られる LLDPE は  $M_w/M_n$  が2 であるにもかかわらず、長鎖分岐 (LCB. long chain branch) を有するために良好な 成形加工性を示す<sup>3)</sup>. LCB は, β-水素脱離 による連鎖移動により生成する末端ビニル 化ポリマー (マクロモノマー) が, 共重合 することにより生成する。 ハフノセン錯体 **2** を MAO で活性化した系も、LCB を有す る LLDPE の製造に有効である<sup>4)</sup>.

1のアミド基をフェノキシ基に変えた錯 体3を'Bu<sub>3</sub>Al-[Ph<sub>3</sub>C][B(C<sub>6</sub>F<sub>5</sub>)<sub>4</sub>] で活性 化した系は、210℃、エチレン圧 150 MPa

| 錯体  | コモノマー  | 重合温度/℃ | $r_{\rm E}^{\dagger 2}$ | $r_{1-A}^{\dagger 2}$ | $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{E}}$ · $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{1-A}}$ |
|---|--------|--------|-------------------------|-----------------------|---|
| Cp <sub>2</sub> ZrCl <sub>2</sub>   | 1-ブテン  | 40     | 55                      | 0.02                  | 1.10  |
| Cp <sub>2</sub> ZrCl <sub>2</sub>   | 1-オクテン | 40     | 32.8                    | 0.05                  | 1.17  |
| rac-Et(Ind) <sub>2</sub> ZrCl <sub>2</sub>  | 1-ブテン  | 50     | 23.6                    | 0.03                  | 0.71  |
| $\mathit{rac}	ext{-}Et(Ind)_2HfCl_2(2)$   | 1-ブテン  | 50     | 6.6                     | 0.10                  | 0.66  |
| $\textit{rac-Et}(H_4Ind)_2ZrCl_2$   | 1-ヘキセン | 40     | 12.1                    | 0.028                 | 0.34  |
| rac-Me <sub>2</sub> Si (Ind) <sub>2</sub> ZrCl <sub>2</sub>                           | 1-オクテン | 40     | 18.9                    | 0.014                 | 0.27  |
| $\textit{rac-Me}_2Si(2\text{-}MeBenz[e]Ind)_2ZrCl_2 \ (\textbf{19})$                  | 1-オクテン | 40     | 10.1                    | 0.118                 | 1.2   |
| $^{i}$ Pr(Cp) (Flu) ZrCl <sub>2</sub> ( <b>20</b> )                                   | 1-ヘキセン | 40     | 5.7                     | 0.05                  | 0.29  |
| $Me_{2}Si(C_{5}Me_{4})(N'Bu)TiCl_{2}~({\bf 1b})$                                      | 1-ヘキセン | 40     | 3.42                    | 0.29                  | 0.99  |
| $Me_{2}Si\left(C_{5}Me_{4}\right)\left(N'Bu\right)TiCl_{2}\ \left(\mathbf{1b}\right)$ | 1-オクテン | 40     | 4.1                     | 0.29                  | 1.19  |
| $({^t\!Bu}\ C_5H_4)\ TiCl_2(\text{O-2, 6-}{^t\!Pr_2C_6H_3})\ \ (\textbf{4})$          | 1-ヘキセン | 40     | 2.46                    | 0.18                  | 0.45  |

表 18.1 代表的シングルサイト触媒のエチレン-1-アルケン共重合におけるモノマー反応性比<sup>†1</sup>

†1 活性化剂, MAO

†2 r<sub>E</sub>:エチレンの反応性比, r<sub>1-A</sub>:1-アルケンの反応性比

20.11).酸化雰囲気([NO] = 0.2%,  $[O_2] = 5\%$ , He バランス)では、触媒後流に NO<sub>x</sub> はほとんど排出されない. [He] = 100%に 切り替えても何も排出されないが、還元雰 囲気( $[H_2] = 10\%$ ,  $[O_2] = 5\%$ , He バラ ンス)に切り替えると、N<sub>2</sub>のみが排出され る.また、酸化雰囲気下で Ba を含む触媒 上に硝酸根が確認されている(図 20.12). これらの実験事実は、排ガス中の NO<sub>x</sub> は、 酸化雰囲気では貴金属上で酸化され、それ に隣接する NO<sub>x</sub> 吸蔵物質と結合して硝酸 塩を形成して触媒中に吸蔵され、還元雰囲 気では硝酸塩が分解し、貴金属上で還元ガ スと反応して窒素に還元されるという、浄 化反応機構を支持している<sup>17)</sup>.



図 20.12 NO<sub>x</sub> 吸蔵還元触媒上の FTIR スペクトル. — N<sub>2</sub> 流中の触媒 — N<sub>2</sub> 流中 [NO] = 0.1%, [O<sub>2</sub>] = 4% 触媒 Pt/Ba/SiO<sub>2</sub>, 温度 673 K.

#### B. NO<sub>x</sub> 吸蔵還元触媒の劣化機構と対応策

触媒の耐久性は実用上からは最も重要な 性能であり、この触媒の開発において最も 困難であった要素である.乗用車の場合 10万km程度の走行後も十分な活性を維 持している必要がある.NO<sub>x</sub>吸蔵還元型触 媒のおもな劣化要因は、従来の三元触媒と 同様熱と被毒であるが、この触媒特有の問 題は硫黄による被毒現象が顕著に現れるこ とである.触媒への硫黄付着は、燃料中に 含まれる硫黄がエンジンで燃焼し、SO<sub>2</sub>と して排ガス中に排出されたものが触媒上に トラップされる現象である.耐久試験を実施した触媒の表面には硫酸イオンが観測さ れるので,触媒の被毒機構は,排ガス中の SO<sub>2</sub>が貴金属上で酸化されて吸蔵物質と反応して硫酸塩を形成し,NO<sub>x</sub>を吸蔵できな くなったものと考えられる.

一方,耐久試験後の触媒では,貴金属近 傍の硫酸塩は理論空燃比,あるいは還元雰 囲気下で徐々に還元,分解する現象が観測 され,硫酸塩の粒子径が小さいほど分解し やすいことがわかる.また,硫酸塩分解に は水素雰囲気が有効である.硫酸塩が分解 して触媒系外に排出されると,触媒活性は 回復する.これらの知見をもとに,硫酸塩 の粒子が成長しにくい Ba,K,Liなどの 吸蔵物質,および硫黄が付着しにくい TiO<sub>2</sub>,さらに硫酸塩を分解しやすくするた めに,排ガス中の未燃 HC と水蒸気から改 質反応によって水素を発生する能力の高い Rh/ZrO<sub>2</sub>が添加物質に選択されている<sup>18)</sup>.

触媒のハニカム基材は従来,セル形状が 四角形のものが用いられてきた.その基材 上に塗布されたウォッシュコートは,図 20.13(左)に示すように,均一ではなく セルコーナー部で厚く,セル平行部で薄く なっている.セルコーナー部の厚いウォッ シュコート部では,水素などの還元ガスの 拡散が十分ではないので,形成された硫酸 バリウムや担体に付着した硫黄が分解,脱 離しにくいことがわかった.そこで,図



図 20.13 四角セル(左)と六角セル(右)モノリ ス触媒のウォッシュコート.100 µm 以 下の厚さにあるウォッシュコートの割 合:66%(四角セル),90%(六角セル).

## 4. 元素別触媒物性・触媒反応 (アルファベット順)

触媒リストでは,各元素にとって代表的な触媒とそれを用いる代表的な反応例をまとめる. イオン半径はR.D. Shannon, *Acta Cryst. A*, **32**(1876)751より引用した.

触媒構成で担持型のものは/(スラッシュ)を、複合型のものは-(ハイフン)を用いて記述して いるが、厳密な区別ではない.

触媒物質は, 触媒を構成する主元素の物質状態や化合物名, あるいは触媒形態を用いて分類 している.

触媒機能は、触媒反応を反映する基本的なもので分類している.

→は代替可能な元素を指す.

| 47       福子配置: [Kr]4d <sup>10</sup> 5s <sup>1</sup> イオン半径(Å) XPS       XAFS         Ag $Ag^+ 2$ 0.67       化合物 3d5/2 BE(eV)       4.0         原子半径(Å):       1.65       4       1.00       AgF       366.9       3.5         金属結合半径(Å):       1.44       SQ 4       1.02       Ag <sub>2</sub> O       367.2       3.0         共有結合半径(Å):       1.53       5       1.09       Ag       368       2.5       Ag <sub>2</sub> (CO         ファンデルワール       6       1.15       第2.0       1.5       Ag2(CO       Ag2(CO         本半径(Å):       1.72       Ag <sup>2+</sup> 4       0.79       1.0       AgCN       Ag2(CO         電気陰性度:       1.93       6       0.94       1.0       Ag       1.0 | ラ | 亡素                             | 基礎物性   |  |  |  | 元素キ  | ャラクタリゼー                                | ションデ   | ータ                    |   |     |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---|-----|
| $Ag^{3^+}$ $0.67$ $0.5$ $0.5$ $0.0$ $6$ $0.75$ $3300$ $3350$ $3400$ $3450$ $E/eV$ $E/eV$ $E/eV$ $E/eV$   |   | 47<br><b>Ag</b><br>銀<br>107.87 | 電子配置: [Kr]4d <sup>1</sup><br>原子半径(Å):<br>金属結合半径(Å):<br>共有結合半径(Å):<br>ファンデルワール<br>ス半径(Å):<br>電気陰性度: | <sup>0</sup> 5s <sup>1</sup><br>1.65<br>1.44<br>1.53<br>1.72<br>1.93 | イオン<br>$Ag^+ 2$<br>4<br>SQ 4<br>5<br>6<br>$Ag^{2^+} 4$<br>6<br>$Ag^{3^+} 4$<br>6 | 半径 (Å)<br>0.67<br>1.00<br>1.02<br>1.09<br>1.15<br>0.79<br>0.94<br>0.67<br>0.75 | XPS<br>化合物<br>AgF<br>Ag <sub>2</sub> O<br>Ag | 3d5/2 BE (eV)<br>366.9<br>367.2<br>368 | XAFS<br>4.0<br>3.5<br>3.0<br>2.5<br>1.5<br>1.0<br>0.5<br>0.0<br>3: | 300 3350 3400<br>E/eV | Ag foil<br>AgSCN<br>Ag <sub>2</sub> (CO <sub>3</sub> )<br>AgCN<br>AgNO <sub>3</sub><br>3450 3 | 500 |

| 触媒構成                                    | 物質分類     | 触媒機能 | 触媒反応                                 |
|---|----------|------|--------------------------------------|
| Ag/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>       | 担持金属     | 還元   | CO,炭化水素によるNO選択還元                     |
|   |          | 酸化   | メタノール過剰での空気酸化によるホルムア                 |
|   |          |      | ルデヒド合成                               |
| $Ag-Cs-Re-O / Al_2O_3 + Cl$             | 担持金属     | 酸化   | エチレン酸化によるエチレンオキシド合成                  |
| Ag-Cs-Cl/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 担持金属     | 酸化   | ブタジエン酸化によるオキシラン合成                    |
| $Pd-Ag/Al_2O_3$                         | 担持金属     | 還元   | アルキンの選択的水素化                          |
| Ag-ZSM-5                                | イオン交換ゼオラ | 還元   | プロパンによる NO 選択還元                      |
|   | イト       |      |                                      |
| Ag-ZSM-5                                | イオン交換ゼオラ | 酸・塩基 | メタンによるアルケンのアルキル化                     |
|   | イト       |      |                                      |
| $Ag\text{-}HPW_{12}O_{40}$              | ヘテロポリ酸塩  | 酸・塩基 | 水素存在下でのアルカンの骨格異性化反応                  |
| $Ag_3VO_4$                              | 複合酸化物    | 光触媒  | 水の光分解(可視光応答型,犠牲剤:AgNO <sub>3</sub> ) |
| $AgNbO_3$                               | 複合酸化物    | 光触媒  | 水の光分解(可視光応答型,犠牲剤:AgNO <sub>3</sub> ) |
| Au-Ag                                   | 金属クラスター  | 酸化   | アルコールの液相酸素酸化によるアルデヒド                 |
|   |          |      | 合成                                   |
| Pd-Ag                                   | 合金       | 膜    | 水素透過                                 |
| $Ag(CO)_n$                              | 金属錯体     | CO付加 | 酸性条件下、アルコールやアルケンのカルボ                 |
|   |          |      | ニル化によるカルボン酸合成                        |